GdFe 合金薄膜における Gd 磁気モーメントと異常ホール効果の相関

蜂須賀 裕重1, 笠谷 雄一2,3, 吉川 大貴2, 塚本 新2

(1日本大学大学院理工学研究科,2日本大学理工学部,3日本学術振興会特別研究員-PD)

Correlation of Gd magnetization and anomalous Hall effect in GdFe alloy thin film

Hiroshige Hachisuka¹, Yuichi Kasatani^{2, 3}, Hiroki Yoshikawa², Arata Tsukamoto²

(1 Graduate School of Science and Technology, Nihon Univ., 2 College of Science and Technology, Nihon Univ.,

³JSPS Research Fellow)

はじめに 異常ホール効果は膜面垂直方向の磁化成分*M_s* cos *θ*に比例する. 代表的な強磁性体である Fe 薄膜 の磁化が形状磁気異方性に打ち勝ち, 膜面垂直方向に飽和させるには約 20 kOe の強磁場を必要とする. その ため, 低磁場でのホール電圧は小さい. そこで, 主として局在電子が磁気モーメントを担う Gd と遍歴電子 が磁気モーメントを担う Fe の磁気モーメントの反平行結合に由来し, 正味の磁化の減少, 形状磁気異方性の 低減, そして磁化補償組成近傍では垂直磁気異方性を発現する GdFe 合金薄膜に着目した. また異常ホール 効果において遍歴電子が磁気モーメントを担う Fe が伝導電子に強く影響を与えるものと考えられるが, 原子 当たりの磁気モーメント量の大きな Gd による寄与度も重要となる. そこで, GdFe 合金薄膜における異常ホ ール効果の広範囲な組成依存性の検討を行った.

実験方法 試料はガラス基板上に SiN (60 nm) / Gd_xFe_{100-x} (20 nm) / SiN (5 nm) / glass sub. (x = 0, 10, 16.7, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 at. %)をマグネトロンスパッタリング法により作製した. 室温にて膜面垂直方向に 外部磁場を印加し, 面内に 0.1mA の電流を印加した際の電流に対して垂直方向の電圧を測定した. また試料 振動型磁力計を用いて 300 K における磁気特性を計測した.

実験結果及び考察 Fig. 1 に電圧計測より求めた異常ホ ール抵抗 (R_{AHE})を示す. R_{AHE} は大きな組成依存性を示 した.特に Gd 組成 x = 25 at.%で膜面垂直方向に磁化容 易軸を持ち無磁場下でも大きな異常ホール効果が計測 された.また, Gd 組成 x = 10, 60 at.%では磁化容易軸が 面内方向となり R_{AHE} は 4kOe においても飽和せず, Gd 組成 x = 25 at.%に比べが低いことが確認された.

Fig. 2 に磁気特性の計測より印加磁場 4 kOe における 磁化角度 θ から求めた磁化角度無依存定数 $|R_{AHE}/\cos\theta|$ を示す. Gd 組成 Fe 薄膜に対し Gd 組成 xの増大と共に $|R_{AHE}/\cos\theta|$ が増加し, Gd 組成 x = 30 at. %において Fe (x = 0 at. %)と比べて最大約 30 倍と大きな効果が得られ た.また, Gd 組成 x > 40 at. %では単調な $|R_{AHE}/\cos\theta|$ の 減少がみられた.次に, Fe の正味の磁化が組成 xの増加 に対し一様に減少すると仮定し見積もった Gd の単位体 積当たりの有効磁気モーメント M_{Gd} の組成依存性を Fig. 2 に示す. Gd 組成 x = 40 at. %程度まで M_{Gd} が増加し, Gd 組成 x > 40 at. %では M_{Gd} が減少した.一方, Fe に対



して Gd の異常ホール係数は約-10 倍大きい^{1,2)}と報告されている.これらのことから異常ホール効果の増減 と Gd の磁気モーメントに強い相関があることが示唆された.

1) T. R. McGuire, J. A. Aboaf and E. Klokholm; IEEE Trans. Magn. 20, 5 (1984)

2) N. V. Volkenshtein, I. K. Grigorova, and G. V. Fedorov; Soviet Physics JETP 50 (1966)

<u>謝辞</u> 本研究の一部は平成 25~29 年度文部科学省私立大学戦略的基盤形成支援事業 (S1311020),平成 26~30 年度文部 科学省科学研究費援助金「新学術領域研究(研究領域提案型)」ナノスピン変換科学の助成を受けて行った. 参考文献